

赤外線アレイセンサフォーラム 2012

- 日時：2012年8月3日（金）10:30～19:00
- 場所：立命館大学びわこ・くさつキャンパス ローム記念館
- 主催：立命館大学
- 後援：立命館大学 先端マイクロ・ナノシステム技術研究センター
- 会費：講演会／展示／ポスター 無料、懇親会：一般 3000円 ♪学生無料♪

■ プログラム（講演者敬称略）

技術講演（5階 大会議室）

10:00～10:30 PAD法による赤外線透過材料のプレス加工

株式会社村田製作所 八戸 啓

10:30～11:00 赤外線による呼気中アルコール検出

株式会社豊田中央研究所 藤塚 徳夫

11:00～11:30 MEMS式赤外線可変分光器

株式会社デンソー 和戸 弘幸

11:30～13:30 昼食

★★★学生会企画★★★（場所は別途連絡します）★★★

展示／ポスター（3階 レセプションホール）

技術講演（5階 大会議室）

13:30～14:00 Infrared Sensor Technology in Korea

KAIST Hee Chul Lee (Korea)

14:00～14:30 IFRPA Development at SCD

SCD Jacob Baeloha (Israel)

14:30～15:00 200万画素SOIダイオード方式非冷却赤外線イメージセンサ

三菱電機株式会社 藤澤 大介

15:00～15:30 休息 & 展示／ポスター

15:30～16:00 2K画素サーモパイル赤外線イメージセンサーの開発

ラピスセミコンダクタ株式会社 渡辺 実

16:00～16:30 赤外線画像の高精細化技術

NEC Avio 赤外線テクノロジー 木村 彰一

16:30～17:00 福島第一原子力発電所の赤外線放射温度計測

防衛省 土志田 実

懇親会／展示／ポスター（3階 レセプションホール）

17:15～19:00 懇親会 & 展示／ポスター 【学生：懇親会参加費無料】